

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2002 年 1 月 31 日 (31.01.2002)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 02/08491 A1

(51) 国際特許分類⁷: C23F 1/30

(21) 国際出願番号: PCT/JP01/06334

(22) 国際出願日: 2001 年 7 月 23 日 (23.07.2001)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2000-225938 2000 年 7 月 26 日 (26.07.2000) JP

(71) 出願人: 三菱瓦斯化学株式会社 (MITSUBISHI GAS
CHEMICAL COMPANY, INC.) [JP/JP]; 〒100-0005 東
京都千代田区丸の内二丁目5番2号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 近藤 治 (KONDO, Osamu); 〒100-0005 東
京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱瓦斯株式会社

Tokyo (JP). 渡辺美泰 (WATANABE, Yoshihiro); 〒125-
0051 東京都葛飾区新宿6丁目1番1号 三菱瓦斯株式会
社 東京研究所内 Tokyo (JP). 石原福三郎 (ISHIHARA,
Fukusaburo). 今井輝彦 (IMAI, Teruhiko); 〒101-0032
東京都千代田区岩本町1丁目2番18号 菱江化学株式
会社 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 大谷 保(OHTANI, Tamotsu); 〒105-0001 東
京都港区虎ノ門3丁目8番27号 巴町アネックス2号館
4階 Tokyo (JP).

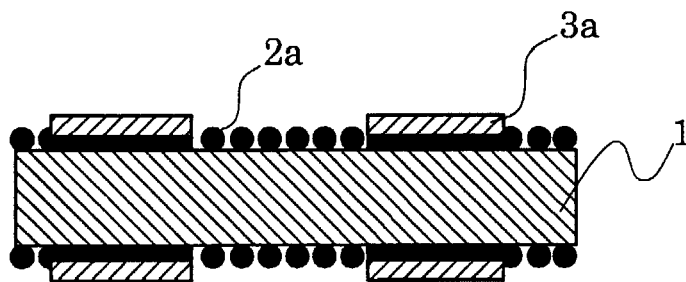
(81) 指定国 (国内): JP, KR, SG.

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PALLADIUM REMOVING SOLUTION AND METHOD FOR REMOVING PALLADIUM

(54) 発明の名称: パラジウム除去液およびパラジウムの除去方法



(57) Abstract: A palladium removing solution, characterized in that it comprises (a) a salt of nitric acid, (b) an agent making palladium oxides soluble in water and (c) water. The palladium removing solution may further comprises (d) a wetting solution and/or (e) a chelating agent. The palladium removing solution can be used for removing the palladium remaining on the surface of an insulating substrate and thereby improving the insulating performance of a circuit pattern, without eroding a copper wiring or roughening the surface of the insulating substrate.

(57) 要約:

本発明のパラジウム除去液は (a) 硝酸塩、(b) パラジウム酸化物を水溶化する水溶化剤および (c) 水を含むことを特徴とする。パラジウム除去液は、(d) 湿潤剤及び/又は (e) キレート化剤を更に含むことが出来る。本発明のパラジウム除去液は、銅配線を浸蝕することなく、また絶縁性基板表面を粗らすことなく、絶縁性基板の表面に残留するパラジウムを除去することができ、回路パターン絶縁性を向上させる。